

薄膜実践セミナーⅣ

産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設(NPF)、名古屋大学未来材料・システム研究所、物質・材料研究機構微細加工プラットフォームは、「薄膜技術実践セミナーⅣ」を2018年11月30日(金)産業技術総合研究所つくば中央にて開催いたします。前半は、スパッタ堆積法、後半は原子層堆積法(ALD)の成膜技術について紹介いたします。オーサーズ・インタビューの時間を設けましたので、講演終了後に講師の先生に個別に質問をすることが可能です。

また、有料実習コースでは、NPFの装置を使用してSrTiO₃誘電体薄膜形成とその結晶性・電気特性評価などを盛り込んだ機能性酸化物材料の開発のための基礎的なスキルを獲得していただけるコースを準備いたしました。産学官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしています。(※セミナー講演のみ、実習コースのみの参加申し込みも可能です。)

◇講演

【日時】2018年11月30日(金)12:55-17:20

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内／申し込み】

<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h30-3/index.html>

◇講演プログラム

- 12:55-13:00 「はじめに」 産総研 共用施設ステーション 多田哲也
- 13:00-13:40 『HfO₂結晶薄膜の強誘電性とデバイス応用の魅力』 産業技術総合研究所 右田真司
- 13:40-14:20 『マグネトロンスパッタによる磁性多層膜等のスパッタ条件依存性』 名古屋大学未来材料・システム研究所 岩田 聡
- 14:20-15:00 『強誘電体メモリーに関する成膜プロセス』 株式会社ULVAC半導体技術研究所 宮口有典
- 15:00-15:20 休憩(オーサーズインタビュー)
- 15:20-16:00 『ALD法を用いた電子デバイスの強誘電体/高誘電体薄膜の作製技術』 物質・材料研究機構 生田目俊秀
- 16:00-16:40 Controlling HfO₂ plasma ALD: doping and substrate biasing to tune film properties for ferroelectric applications』 オックスフォード・インストルメンツ株式会社 伊藤昌平
- 16:40-17:00 『NPFの原子層堆積(ALD)装置による成膜紹介』 産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設 山崎将嗣
- 17:00-17:20 オーサーズインタビュー

◇実習コース

【日時】平成30年12月から平成31年2月の間の3日間

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟ナノプロセッシング施設(NPF)

【実習内容】

SrTiO₃誘電体薄膜形成とその結晶性・電気特性評価などを盛り込んだ機能性酸化物材料の開発のための基礎的なスキルを習得します。

【参加費】50,000円/人

【定員】3名(同時に実施いたします)

【案内／申し込み】<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h30-3/index.html>

主催:

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設(NPF)

名古屋大学未来材料・システム研究所

物質・材料研究機構微細加工プラットフォーム

共催

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール tia-npf-school3@aist.go.jp